

Zápisnica

Zo zasadnutia Rady pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania Anorganická technológia a materiály / Committee for the field of habilitation procedure and inaugural procedure Inorganic technology and materials

Zo dňa 11.12.2025

Prítomní

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., Dr. h.c. prof. Ing. Marek Liška, DrSc., doc. Ing. Róbert Klement, PhD., doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.

Na základe vnútorného dokumentu 2-U-013 „Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD v Trenčíne“, predseda Rady pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania Anorganická technológia a materiály prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. zvolal zasadnutie, ktoré sa konalo 11.12.2025

Program:

1. Otvorenie, privítanie členov Rady pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania Anorganická technológia a materiály
 2. Schválenie dokumentov potrebných na úpravu habilitačného konania a inauguračného konania. Dokumenty na schválenie: Charakteristika úpravy HIK, Vplyv úpravy HIK, VUPCH a VTC.
 3. Diskusia
 4. Záver
-

1. Predseda Rady pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania- prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., otvoril zasadnutie a privítal členov Rady pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania Anorganická technológia a materiály (ďalej len RHIK). Program rokovania bol bez pripomienok schválený.
2. RHIK odsúhlasila dokumenty potrebné na podanie **Žiadosti o úpravu odboru habilitačného konania a inauguračného konania Anorganická technológia a materiály** a to menovite: Charakteristiku úpravy HIK, Vplyv úpravy HIK, VUPCH a VTC prof. RNDr. Karla Macu, Dr.
3. Predseda RHIK poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie Rady pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania Anorganická technológia a materiály.

V Trenčíne, 11.12. 2025

Zapísala:
Mgr. Michaela Matejová

Schválil:
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
predseda RHIK